

证书号第8646072号



专利公告信息

发明专利证书

发明名称：含TaC/Ta₂C梯度涂层的石墨件及其制备方法

专利权人：浙江六方半导体科技有限公司

地址：311800 浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道千禧路9号9号楼

发明人：林宇;陈爱盛;肖绍铸;何少龙

专利号：ZL 2024 1 1703774.0

授权公告号：CN 119735451 B

专利申请日：2024年11月25日

授权公告日：2026年01月16日

申请日时申请人：甬江实验室

申请日时发明人：林宇;陈爱盛;肖绍铸;何少龙

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，并予以公告。
专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

局长
申长雨

申长雨

